

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 18 年 3 月 23 日 (2006.3.23)

【公開番号】特開 2004-281163 (P2004-281163A)
 【公開日】平成 16 年 10 月 7 日 (2004.10.7)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-039
 【出願番号】特願 2003-69314 (P2003-69314)
 【国際特許分類】

H 0 1 M 4/04 (2006.01)
C 0 1 G 51/00 (2006.01)
H 0 1 M 4/02 (2006.01)
H 0 1 M 4/58 (2006.01)
H 0 1 M 10/40 (2006.01)

【F I】

H 0 1 M 4/04 Z
 C 0 1 G 51/00 A
 H 0 1 M 4/02 C
 H 0 1 M 4/58
 H 0 1 M 10/40 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 2 月 6 日 (2006.2.6)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 5
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 1 5】

含フッ素化合物の容器基質との反応による溶着を抑制するため、上記セラミックス被覆層は、含フッ素化合物との化学反応性が低いスピネル，マグネシア，ジルコニアおよびアルミナの少なくとも 1 種からなることが好ましい。アルミナとしては、リチウムやフッ素との化学的反応性の乏しい アルミナが最適である。